

УДК 538.95—405 : 539.12.04; 548 : 539.12.04

© 1990

## ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СПИН-РЕШЕТОЧНУЮ РЕЛАКСАЦИЮ В ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ С ТЯЖЕЛЫМИ ПРИМЕСЯМИ

Л. Л. Бушвили, И. И. Топчян

Методом неравновесного статистического оператора (НСО) Зубарева [1] исследована спин-решеточная релаксация в находящихся под лазерным облучением щелочно-галлоидных кристаллах (ЩГК) с тяжелыми примесями. Получено кинетическое уравнение для обратной температуры спиновой подсистемы, а также выражение для времени спин-решеточной релаксации как при высоких, так и при низких температурах. Показано, что в стационарном состоянии система, состоящая из спиновой подсистемы и подсистем локальных и кристаллических фононов, находится в неэргодическом состоянии, причем температура спиновой подсистемы ниже температуры подсистемы кристаллических фононов.

Разогрев локальных колебаний примесей в результате резонансного взаимодействия электромагнитного лазерного излучения с электронной подсистемой ЩГК [2] приводит к нарушению теплового равновесия в фононной системе кристалла. В [3, 4] рассматривались терморелаксационные процессы, индуцированные лазерным излучением в ЩГК с тяжелыми и легкими примесями. С другой стороны, неравновесные процессы в фононной системе оказывают влияние на спин-решеточную релаксацию, обусловленную перераспределением энергии между разогретой подсистемой локальных колебаний и спиновой подсистемой, а также подсистемой кристаллических фононов. В случае примесей со спином  $I > 1/2$  обмен энергией между спиновой и фононной подсистемами осуществляется в результате квадрупольного электрического взаимодействия [5]. Гамильтониан квадрупольного взаимодействия  $H_Q$  в динамической решетке можно представить в виде

$$H_Q = H_Q^{(0)} + H_Q^{(1)} + H_Q^{(2)} + H_Q^{(3)} + \dots, \quad (1)$$

где  $H_Q^{(0)}$  — взаимодействие квадрупольного момента ядра  $Q$  с внутркристаллическим электрическим полем в статической решетке, которое в кристаллах с кубической симметрией равно нулю;  $H_Q^{(i)}$  ( $i=1, 2, \dots$ ) — вклад, обусловленный колебаниями атомов

$$H_Q^{(1)} = \sum_{n, \alpha} C_n^\alpha v_n^\alpha, \quad (2)$$

$$H_Q^{(2)} = \sum_{\substack{n, n' \\ \alpha, \beta}} C_{nn'}^{\alpha\beta} v_n^\alpha v_{n'}^\beta, \quad (3)$$

$$H_Q^{(3)} = \sum_{\substack{n, n', n'' \\ \alpha, \beta, \gamma}} C_{nn'n''}^{\alpha\beta\gamma} v_n^\alpha v_{n'}^\beta v_{n''}^\gamma, \quad (4)$$

где  $v_n^\alpha = u_n^\alpha - u_0^\alpha$  —  $\alpha$ -компонента смещения  $n$ -го иона относительно примеси, расположенной в начале координат,

$$C_{\alpha}^{\alpha} = \frac{1}{6} \sum_{\mu, \pi} Q_{\mu\nu} \left. \frac{\partial V_{\mu\nu}}{\partial x_{\pi}^2} \right|_0, \quad \bar{C}_{\alpha\beta}^{\alpha\beta} = \frac{1}{12} \sum_{\mu, \nu} Q_{\mu\nu} \left. \frac{\partial^2 V_{\mu\nu}}{\partial x_{\alpha}^2 \partial x_{\beta}^2} \right|_0,$$

$$C_{\alpha\beta\gamma}^{\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{36} \sum_{\mu, \nu} Q_{\mu\nu} \left. \frac{\partial^3 V_{\mu\nu}}{\partial x_{\alpha}^2 \partial x_{\beta}^2 \partial x_{\gamma}^2} \right|_0,$$

$$V_{\mu\nu} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial x_{\mu} \partial x_{\nu}} \right|_0,$$

$V$  — потенциал электрического поля,  $Q_{\mu\nu}$  — тензор квадрупольного момента.

Предполагая, что в кристалле с разогретой подсистемой локальных фононов число последних на малых расстояниях от примесного центра, на котором эффективно квадрупольное взаимодействие, значительно превышает число кристаллических фононов и учитывая отсутствие дисперсии локальных фононов для данного типа примеси, в первом приближении достаточно рассмотреть только релаксационные процессы с участием одновременно и локальных, и кристаллических фононов. В случае тяжелых примесей, локальные колебания которых являются целевыми, это — трехфононные процессы, описываемые гамильтонианом  $H_Q^{(3)}$ . Действительно, согласно закону сохранения энергии,

$$\omega_z = \omega_{qj} + \omega_{q'j'} + \omega, \quad (5)$$

где  $\omega_z$  — частота локальных колебаний,  $\omega_{qj}$  — частота  $j$ -й ветви акустических колебаний с волновым вектором  $q$ ;  $\omega$  — зеемановская частота спиновых переходов (в (5), как и во всех последующих расчетах, предполагается  $\hbar=1$ ). Как видно из (5), в случае двухфононных процессов разность частот локального и кристаллического колебаний равна частоте  $\omega$  спиновых переходов, которая на несколько порядков меньше частоты колебаний атомов, т. е.  $\omega_z \simeq \omega_{qj}$ . Такие колебания следует рассматривать как квазилокальные [6]. Однако взаимодействие лазерного излучения с электронной подсистемой примесного кристалла, в спектре которого имеются квазилокальные колебания, не приводит к преимущественному разогреву последних из-за отсутствия эффекта «узкого горла» [2] в канале обмена энергией между подсистемами квазилокальных и кристаллических колебаний и всей фононной системе кристалла можно приписать одну и ту же температуру  $T$ . Релаксационные процессы в такой системе исследованы в работе [6].

Используя выражение для амплитуды локальных колебаний тяжелой изотопической примеси [7] и учитывая, что

$$\bar{C}_{\alpha\beta\gamma}^{\alpha\beta\gamma} \equiv \partial^3 V_{\mu\nu} / \partial x_{\alpha}^2 \partial x_{\beta}^2 \partial x_{\gamma}^2 \Big|_0$$

быстро спадает с ростом расстояния от примеси, можно аналогично [8] выражение для квадрупольного взаимодействия в представлении вторичного квантования представить в виде

$$H_Q^{(3)} = R \sum_{m=-2}^2 H_m, \quad (6)$$

где  $R = eQ/24I(2I-1)$ ;  $e, I$  — заряд электрона и спин ядра примеси,  $H_m = H_{\mp}^m H_P^{-m}$ ,  $H_{\pm}^1 = I_{\pm} I_x + I_x I_{\pm}$ ,  $H_{\pm}^2 = (I_{\pm})^2$ ,  $H_{\pm}^3 = 3I_{\pm}^2 - I^2$ ,  $I_{\pm} = I_x \pm iI_y$ .

$I_x, I_y, I_z$  — компоненты спина вдоль соответствующих осей (предполагается, что ось  $z$  направлена вдоль постоянного магнитного поля  $H_0$ ),

$$H_P^{\pm} = \sum_{qj, q'j', \gamma} B_m \begin{pmatrix} qj \\ q'j' \\ \gamma \end{pmatrix} (b_{-q}^+ b_{-q'j'}^+ a_{\gamma} + b_{qj} b_{q'j'} a_{\gamma}^{\dagger}) (\omega_{qj} \omega_{q'j'})^{1/2} \omega_{\gamma}^{-1/2},$$

$$B_{\pm 1} \begin{pmatrix} qj \\ q'j' \\ \gamma \end{pmatrix} = -2 \sum_{\substack{n, n', n'' \\ \alpha, \beta, \gamma; k, k'}} \left( \frac{e^{\alpha\beta\gamma}}{\alpha\beta\gamma} \pm i \frac{e^{\alpha\beta\gamma}}{\alpha\beta\gamma} \right) C_{\alpha\beta\gamma}^{\alpha\beta\gamma, k, k'}, \quad B_{\pm 2} \begin{pmatrix} qj \\ q'j' \\ \gamma \end{pmatrix} =$$

$$= - \sum_{\substack{n, n', n'' \\ \alpha, \beta; k, k'}} \left( \zeta_{nn'n''}^{xx} - \zeta_{nn'n''}^{yy} \pm 2i \zeta_{nn'n''}^{xy} \right) \varphi_{nn'n''}^{\alpha\beta, kk'}, \quad B_0 \begin{pmatrix} \mathbf{q}^j \\ \gamma \end{pmatrix} = -2 \sum_{\substack{n, n', n'' \\ \alpha, \beta; k, k'}} \zeta_{nn'n''}^{zz} \varphi_{nn'n''}^{\alpha\beta, kk'}$$

$$\varphi_{nn'n''}^{\alpha\beta, kk'} = W_{n, k}^\alpha(\mathbf{q}^j) W_{n', k}^\beta(\mathbf{q}'^j) g_{nn'} v_{jj'}^{kk'}, \quad W_{n, k}^\alpha(\mathbf{q}^j) = (2NM)^{-1/2} r_n^k p_\alpha(\mathbf{q}^j),$$

$$g_{nn'} = (2m)^{-1/2} \left[ \frac{A}{r_n} - 1 - \delta A \right], \quad A = \frac{\Delta m}{m} \frac{V_0}{4\pi l^2} \frac{\omega_1^2}{\omega_1^2 - \omega_2^2}, \quad \Delta m = m - M, \quad \delta = 1/l,$$

$$v_{jj'}^{kk'} \equiv v_j^k v_{j'}^{k'},$$

где  $l$  — длина убывания амплитуды локальных колебаний;  $v_j^k$  —  $k$ -я компонента скорости распространения колебаний в  $j$ -й ветви; параметр  $\gamma = 1, 2, 3$  нумерует ветвь локальных колебаний;  $M, m$  — массы центров тяжести элементарной ячейки без примеси и с примесью соответственно;  $\omega_1$  — частота колебаний нижней границы оптической полосы;  $N$  — число элементарных ячеек;  $V_0$  — их объем;  $r_n$  — расстояние от примесного центра до  $n$ -го узла кристаллической решетки;  $p_\alpha(\mathbf{q}^j)$  —  $\alpha$ -компонента вектора поляризации акустической моды ( $\mathbf{q}^j$ );  $a^\dagger, b^\dagger$  ( $a, b$ ) — операторы рождения (уничтожения) локальных и кристаллических фононов соответственно.

Используя развитый Зубаревым метод НСО [1], можно получить кинетическое уравнение для обратной температуры  $\beta_I = 1/kT_I$  ( $k$  — постоянная Больцмана) спиновой подсистемы

$$d\beta_I/dt = (-1/\tau) [\beta_I - \beta_l + \alpha(\beta_l - \beta_I)], \quad (7)$$

где  $\beta_l, \beta_I$  — обратные температуры подсистем локальных и кристаллических фононов;  $\tau \equiv \tau_1$ ;  $\alpha = \tau_1/\tau_2$ ;  $\tau_1, \tau_2$  — характерные времена релаксаций

$$\tau_{1(2)} = - \frac{\partial \langle H_1 \rangle_q}{\partial \beta_I} \left[ \int_0^1 d\lambda \int_{-\infty}^0 L_{1(2)}(t, \lambda E) dt \right]^{-1}. \quad (8)$$

$H_I$  — гамильтониан зеемановского взаимодействия;  $t$  — время;  $\lambda$  — параметр интегрирования [1];  $E = \sum_{n=1}^3 \beta_n H_n$ ; индекс  $n=1$  нумерует спиновую подсистему,  $n=2, 3$  — подсистемы локальных и кристаллических фононов соответственно;  $L_1 = \langle K_1(t, \lambda E) K_1 \rangle_q$ ,  $L_2 = \langle K_2(t, \lambda E) K_1 \rangle_q$  — корреляционные функции;  $K_n = i [H_Q^{(3)}, H_n]$  — поток энергии  $n$ -й подсистемы

$$K_n(t, \lambda E) = e^{\lambda E} e^{iHt} K_n e^{-iHt} e^{-\lambda E}, \quad (9)$$

$\langle \dots \rangle_q = \text{Sp}(\rho_q \dots)$  — среднее значение соответствующей величины;  $\rho_q = (\text{Sp} e^{-E})^{-1} e^{-E}$  — квазиравновесная матрица плотности;  $H = \sum_{n=1}^3 H_n + H_Q^{(3)}$  — полный гамильтониан рассматриваемой системы.

Как видно из (7), в стационарном состоянии

$$\beta_I = \beta_l + \alpha(\beta_l - \beta_I). \quad (10)$$

При лазерном облучении  $\beta_I^0 \ll \beta_l^0$  и, следовательно,

$$\beta_I^0 = (1 + \alpha) \beta_l^0. \quad (11)$$

Следует отметить, что (10) справедливо и в случае  $\beta_l^0 - \beta_I^0 = 0$ , т. е. при равномерном разогреве фононной подсистемы, когда, строго говоря, при вычислении  $\alpha$  необходимо учесть многоквантовые процессы в фононной системе, протекающие без участия локальных фононов. При этом, как видно из (10), в стационарном состоянии рассматриваемая система будет эргодической ( $\beta_l^0 = \beta_I^0 = \beta_n^0$ ).

В зависимости от соотношения между температурами подсистем локальных и кристаллических фононов можно выделить два случая.

1)  $\beta_{l\omega_1} \ll 1$ ,  $\beta_{1\omega_1} \ll 1$ , т. е. имеет место сильный разогрев всей фононной подсистемы. Вычисляя корреляторы  $L_1$  и  $L_2$  и используя (8), для времени релаксации  $\tau$  и параметра  $\alpha$  можно получить следующие выражения:

$$\tau = \frac{Cx^2}{\chi_2} \frac{\beta_1 \beta_1^0}{\omega_D^2}, \quad \alpha = x \left( \frac{\chi_1}{\chi_2} + \beta_l \omega_D \right), \quad (12), (13)$$

где  $x = \omega_1 / \omega_D$ ,  $\omega_D$  — частота Дебая,

$$\chi_1 = \frac{2}{3} x - \frac{1}{2}, \quad \chi_2 = \left( \chi_1 - \frac{1}{2} \right) \frac{x}{2} + \frac{1}{5}, \quad (14), (15)$$

$$C = \frac{5}{2} (GS)^{-1}, \quad G = \frac{R^2}{2\pi^3} \left( \frac{V_0}{v_0^3} \right)^2 (4d - 3), \quad d = I(I + 1),$$

$$S = N^2 \sum_{m, j, j', \gamma} m^2 B_{-m}^{jj'\gamma} B_m^{jj'\gamma}.$$

Как видно из (12), время релаксации  $\tau$  обратно пропорционально произведению температуры подсистемы локальных фононов и квадрата температуры подсистемы кристаллических фононов. Используя (13)–(15), легко показать, что при любых значениях  $x > 1$  параметр  $\alpha > 0$ . При этом, согласно (11),  $\beta_1^0 > \beta_l^0$  и, следовательно при лазерном облучении сильно разогретого кристалла в стационарном состоянии вся система является неэргодической, причем температура спиновой подсистемы ниже температуры подсистемы кристаллических фононов.

Следует отметить, что при высоких температурах для скорости релаксации зависимость  $\tau^{-1} \sim T_i^2$  справедлива и для двухфононных процессов, протекающих в подсистеме кристаллических фононов. Поэтому трехфононные процессы будут вносить доминирующий вклад в спин-решеточную релаксацию лишь при условии  $T_x \gg T_l$ .

2)  $\beta_{l\omega_1} \gg 1$ ,  $\beta_{1\omega_1} \ll 1$ , т. е. имеет место разогрев локальных колебаний при низких температурах. Как показывают расчеты, в этом случае

$$\tau = \frac{Cx^3}{\chi_2'} \frac{\beta_l \beta_l^0}{\omega_D^4}, \quad \alpha = 3x \frac{\chi_1'}{\chi_2'} - 1, \quad (16), (17)$$

где

$$\chi_1' = \frac{x^2}{4} - \frac{2}{5} x + \frac{1}{6}, \quad \chi_2' = \frac{x^3}{4} - \frac{3}{5} x^2 + \frac{x}{2} - \frac{1}{7}.$$

Таким образом, согласно (16), при облучении лазером кристалла при низких температурах время спин-решеточной релаксации обратно пропорционально произведению температур подсистем локальных и кристаллических фононов. Скорость релаксации при этом  $\tau^{-1} \sim (T_l/T_D) T_x$ , тогда как при низких температурах в случае двухфононных процессов в подсистеме кристаллических фононов  $\tau^{-1} \sim (T_l/T_D)^2$ . Однако ввиду того что  $T_l \ll T_D$ , а  $T_x \gg T_l$ , основной вклад во время спин-решеточной релаксации описывается выражением (16).

При более слабом разогреве локальных колебаний (степень разогрева определяется величиной электрон-колебательной связи, обуславливающей передачу энергии лазерного излучения фононной подсистеме, и интенсивностью лазерного излучения [2]), когда  $\beta_{x\omega_x} \gg 1$ ,  $\tau \sim e^{\beta_l \omega_x}$ , т. е. время спин-решеточной релаксации экспоненциально растет при повышении температуры подсистемы локальных фононов.

Согласно (11), (17), в стационарном состоянии

$$\beta_1^0 = 3x \frac{\chi_1'}{\chi_2'} \beta_0.$$

Этот результат справедлив как при сильном, так и при слабом разогреве локальных колебаний. Легко показать, что  $\chi_1'/\chi_2' > 0$  при любых значениях  $x > 1$  и при всех разумных значениях  $x$   $\beta_1^0 > \beta_l^0$ , т. е., как и в первом случае высоких температур, разогрев локальных колебаний при низких

температурах переводит рассматриваемую систему в неэргодическое состояние, причем в стационарном состоянии спиновая подсистема разогрета слабее подсистемы кристаллических фононов.

Как показывают оценки, время спин-решеточной релаксации для системы  $KI : Cs^+$  (в случае «2»)  $\sim 0.1$  с.

#### Список литературы

- [1] Александров И. В. Теория магнитной релаксации. М.: Наука, 1975. 400 с.
- [2] Kovarskii V. A., Pоров E. A., Chaikovskii I. A. // Phys. St. Sol. 1975. V. 67. N 2. P. 427—433.
- [3] Буишвили Л. Л., Топчян И. И. // ФТТ. 1986. Т. 28. № 10. С. 3000—3005.
- [4] Буишвили Л. Л., Топчян И. И. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 3. С. 60—63.
- [5] Сликтер Ч. Основы теории магнитного резонанса. М.: Мир, 1967. 324 с.
- [6] Гиоргадзе Н. П., Харадзе Г. А. // ЖЭТФ. 1967. Т. 53. № 4 (10). С. 1390—1394.
- [7] Косевич А. М. Основы механики кристаллической решетки. М.: Наука, 1975. 400 с.

Институт физики АН ГрузССР  
Тбилиси

Поступило в Редакцию  
22 февраля 1990 г.